Irradiation Processing of Polyethylene



#### 内 容 梗 概

ポリエチレンに強エネルギー放射線を照射して架橋させて耐熱性を向上させることは現在関心の的と なっている。ここではまず線源としての放射性同位元素と粒子加速器について簡単にその経済性を比較 し、市販の照射ポリエチレンの性質を述べる。次にポリエチレンに放射線を照射した場合生ずる変化を 説明し、放射線架橋の実験結果は分子量分布を考慮したわれわれの方法によってかなりよく説明される ことを述べる。最後にポリエチレンにアクリロニトリルおよびスチレンのグラフト重合ならびに架橋に 及ぼすジビニルベンゼンの効果について実測値によって説明する。

# 1. 緒

10

言

ポリエチレンに放射線を照射して架橋させて耐熱性を 向上させる研究は Charlesby 氏<sup>(1)</sup> が原子炉内でポリエ チレンに照射して,これが不融不溶となることを発表し て以来急激に関心が高まり,ほうぼうで研究されるよう になった。G.E. 社ではそれ以前からすでに共振変圧器 (Resonant transformer)を用いて高エネルギー電子線 資料によれば次のようである。 G. E. 社では Irrathene 101,同じく 201 (酸化防止剤入り),202 (カーボンブラ ック入り),さらに 110 (101 相当,強力品),210 (201 相当,強力品),212 (202 相当,強力品)があり,厚みも種 々のものが作られている由である<sup>(3)</sup>。なお G. E. 社では Irrathene を作るのに 1 MeV の共振変圧器を3 台装備 して年に 725,700 kg (160 万ポンド) 製造しているとい う<sup>(4)</sup>。また American Agile Corp. では Agilene-HT

を炭化水素に照射する研究を行っており、ポリエチレン についても品質改善の研究が行われて、1953~4年には Irrathene という商品名で耐熱性ポリエチレンが発表さ れた(2)。その後、さらに3、4の会社からも市販されて いる。また最近は,放射線により高分子に異なる性質を 持ったほかの高分子の分枝を付けるグラフト重合の研究 が盛んとなり、これに要する照射線量が少なくてすむこ と, 高分子の性質をいろいろ望みの性質に変性できるこ となどの特長があるため非常に有望視されているが、ポ リエチレンについても染色性の改善, 耐熱性の向上など を目的としていろいろ研究されている。以上のような放 射線によるポリエチレンなど高分子の品質改善について は、まだ着手されてから比較的日も浅いので、正確な将 来の見通しは困難であるが,今後原子力の開発とともに 急速に進展するものと考えられる。ここでは市販照射ポ リエチレンの性質, 照射線源および照射の経済性につい て簡単に述べ、放射線照射によるポリエチレンの架橋お よびグラフト重合について、われわれの実験室で行った ことを中心としてほかの文献も参照して紹介したいと思 50

#### 2. 照射市販ポリエチレンの性質

現在までに市販されている照射ポリエチレンは手許の

*	日立製作所中央研究所
**	口子制作正体经施工用下的八

日立製作所絶縁物工場下館分工場

なる名称で売出している。 Sequoia 社<sup>(5)</sup>は Stanford Research Institute と共同して特殊な添加剤をポリエチ レンに混和して放射線を照射する Sequoia Process と称 する方法を開発し、この方法で作られたものは Hyrad と 称せられおもに電線などが作られているようであるが, Grace 社はこの技術により Phillips 法の高密度ポリエ チレンに照射して新しい用途を開発しているという。 Hyrad の特長は熱安定性のよいことで、常用 150°Cに耐 え、200°Cでかなりの時間、350°Cの溶融浴に短時間つけ ても大丈夫という。イギリスでも Tube Investment で 照射ポリエチレンをポリエチレンの3倍程度の値段で売 り出しており、この技術で Mersey Cable Works では高 温で使用できる照射ポリエチレン被覆電線としてMerad を売り出しており,瞬間的過電流に耐え,450°Cでも多少 の強度を持つという<sup>(6)</sup>。 さらに, G.E. 社では押出し 可能な Irrathene E-234 を発表し、これは薬品による応 力ヒビ割れに非常に強いという。

次に照射ポリエチレンの性質を 第1,2表 に示す(主 として Irrathene 101,201 および Agilene-HTの数値 であるが他もほぼ同じと思われる)<sup>(7)</sup>。

## 3. 放射線源<sup>(8)</sup>

放射線加工をする場合,線源が問題となる。有効な線 源としては高圧電子線,γ線,X線,中性子線,重陽子 線,α線など,場合によっては紫外線も考えられる。高

---- 3 -----

絶縁材料特集号 第2集

日立評論 別冊第31号

第1表 照射ポリエチレンの性質

引	張	荷	重	(kg/cm <sup>2</sup> )	117.00~155.00(1,800~2,200p.s.i.)
ヤ	ン	グ	率		18,000~20,000
伸			び	(%)	500~600
比			重		0.92
2	з 7	硬	さ		48
熱	伝導	[率]	(cal	/s/cm <sup>2</sup> /°C/cm)	8.0×10-4
線	膨	脹	率	$(cm/cm/^{\circ}C)$	7.88×10 <sup>-5</sup> (2×10 <sup>-4</sup> in/in/°C)
誘	電	率	(60	$c \sim 10,000 \text{ Mc})$	2.3
力		率	(60	$c\sim 10,000 \text{ Mc})$	<0.0005

接触応力ヒビ割れ			割れ	常温氷酢酸または Igepal 溶液中で1年後も 安全,75℃で2,000時間安全
耐	薬	品	性	アルカリ,酸(硝酸を除く)に良好,ほかの 大部分の水溶性薬品に良好
耐	溶	剤	性	大部分の有機溶剤に60°C以下で良好,60°C以 上では炭化水素,塩化炭化水素,芳香族系溶 剤に膨潤

第2表 照射ポリエチレンの耐薬品性

圧電子線源としてはファンデグラフ起電機,共振変圧器, ベータートロン,直線形加速器(Linear Accelerator)な ど,  $\gamma$ 線源としては <sup>60</sup>Co,核燃料廃棄物(またはこれか ら分離された <sup>137</sup>Cs),中性子源としては原子炉などであ る。わが国のこの方面の先駆的研究は理研のサイクロト ロンによる重陽子線で行われたが<sup>(9)</sup>,最近二,三の研 究室でファンデグラフ起電機が稼動しているようであ る。 に算定し得ないが、この表からみると核燃料廃棄物が安 く利用できるようになるか、特殊用途以外は加速器のほ うが有利であり、現在のところ共振変圧器が最も有利と 考えられる。なお10<sup>6</sup>rad=10<sup>8</sup>erg/g=2.8×10<sup>-3</sup>kWh/kg であり、ポリエチレンの架橋には大体10×10<sup>6</sup>rad程度必 要と考えられるから稼動条件を決めれば照射に要する大 体の価額を算定することができる。

## 4. ポリエチレンの放射線照射

ポリエチレンに放射線を照射した場合主として次の諸 変化を生ずる。(1)水素およびガスの発生,(2)流動点が 上昇しついには不融となる,(3)ゲル量が増大し溶媒に 不溶となる,(4)構造変化が生じ,ことに二重結合部に 変化が生ずる。これらの現象からポリエチレンに放射線 を照射した場合生ずる反応,ことに架橋反応についてい ろいろ考察されているが,まだこれらの反応については 十分明らかになっていない。なお空気中で照射する場合 は酸素のために酸化が起り,酸素の存在しない場合とは かなり異なる結果を生ずるが,これについてはあとで述 べる。次にポリエチレンにγ線を照射した場合のわれわ れの得た結果<sup>(11)</sup> について述べる。

4.1 水素生成量および生成ガスの組成

**第3表**に<sup>60</sup>Co, <sup>137</sup>Cs, ファンデグラフ装置, 共振変圧 器の経済性を比較する<sup>(10)</sup>。

第3表はいけだ氏<sup>(10)</sup>の報告から再録したものであり, 表中()内は Libby の想定した窮極価額であるが少し安 すぎるようである。10年後の値段として120円/キュリー くらいとも推定されている<sup>(10)</sup>。なお <sup>60</sup>Co 算定の基礎は 次のようである。<sup>60</sup>Co が毎秒7線の形で出すエネルギ ーは (1.17+1.33)×( $3.7\times10^{10}$ )=9.25×10<sup>10</sup>MeV である。 1 MeV=1.602×10<sup>-6</sup> エルグであるからこの値は (9.25× 10<sup>10</sup>)×1.602×10<sup>-6</sup>=14.8×10<sup>4</sup>エルグ/秒になる。これは (14.8×10<sup>4</sup>)×10<sup>-7</sup>=0.0148 ワットにあたる<sup>(8)</sup>。<sup>137</sup>Cs が 出す7線のエネルギーは 0.66 MeV であるから同じ計算 で表のようになる。RIの場合は照射に要する価額は簡単

ポリエチレン (ペトロテン 210)の真空中γ線照射で は生成ガスのうち水素が95~96%で、残りは大部分ガス 状炭化水素であった。ポリエチレンの原子炉内照射では 水素 96~98%(1)(12), 真空中高圧電子線照射ではポリエ チレン(DYNH), ポリメチレン, オクタコサン(C<sub>28</sub>H<sub>58</sub>) からはそれぞれ水素 85, 99.9, 91%(13) と報告されてい る。これらの結果から, 側鎖は放射線により切れやすい ものと考えられる。なお吸収エネルギー100 eVあたりの 水素生成量 GH2 はわれわれの実験では 2.5~2.8 と求め られたが, Miller 氏ら<sup>(13)</sup>は高圧電子線により DYNH, ポリメチレン,オクタコサンでそれぞれ 5.7, 5.4, 4.3 を 得, Charlesby 氏ら<sup>(14)</sup>は 3.1, Dole 氏ら<sup>(15)</sup>は4.0を得てい る。一般に炭化水素(芳香族を除く)の GH2 は5~6 で Dewhurst 氏<sup>(16)</sup>によれば n-hexane ではこのうち2程度 がラジカル過程  $(H \cdot + RH \rightarrow R \cdot + H_2)$ , 残りの半分ず つが分子過程 (2RH→ $R_2$ + $H_2$ ), および二重結合生  $\vec{\mathbf{K}}(\mathbf{RH} \longrightarrow \mathbf{C} = \mathbf{C} + \mathbf{H}_2)$ から生ずるとされている。

	I		電 子 加 速 器					
-	<sup>60</sup> Co	137Cs			58.03		ファンデグラフ	共振変圧器
照射エネルギー出力	1.5×10-5 (22)~1,100円	0.4×10-5 (36)~1,800円	製	fΈ	숤	社	High Voltage 社	G.E.社
(KW/4 1 ) - )			容			量	3MeV,1mA,出力3kW	2MeV,0.6mA,出力10kW
キュリーあたりの価額			機	ħ	戌	代	4.5千万円	4.3千万円
1kWあたりの線源買入れ価額	(0.14)~7.2千万円	(0.9)~45千万円	1kWあ	たりの終	泉源買	入れ価額	1.5千万円	0.4千万円

第3表 線源としてのRI(放射性同位元素)と加速器の経済比較



第1図 Petrothene 210 および Marlex-50の 流動点と照射量との関係

#### 4.2 流 動 点

円形寒暖計の水銀部のへこみに試料の小片をのせて温度を上昇させ10倍の顕微鏡下で流動の始まる温度を観察した。この温度を流動点として第1図に示す。照射量の少ないものは融ける範囲が長くあまりはっきりしなかった(図の点線で示す)。試料のフィルムは方向性があり、ペトロテンはすべて105~106℃で変形収縮し、照射量の大きいものほど変形は小さい。81 Mrep 照射のものおよび Irrathene 201 はほとんど変形しなかった。しかし実験に使用した Marlex-50 はロールで加熱圧延後急冷した



第2図 Petrothene 210 および Marlex-50 の ゲル量と照射量との関係

#### 4.3 溶 解 度

 $0.01 \sim 0.03$ gの膜状試片を70メッシュの銅網に包み, 20 $\phi$ の試験管中で,低密度ポリエチレン (Petrothene 210)の場合は80°Cで15時間,高密度 (Marlex-50)の場 合は110°Cで21時間加熱してゾル部分を十分溶出して残 ったゲル量を測定した。結果を第2図に示す。同じ照射 量に対するゲル量は Petrothene のほうがいくぶん多 く,見かけの架橋効率が良くなっている。

架橋構造を持つ高分子の溶解度は架橋密度のほかに, 平均分子量と分子量分布に依存する。Flory氏<sup>(19)</sup>は分布 のない場合ゾルの重量分率Sと架橋指数7(数平均分子 量あたりの架橋している単位の数)との間に

$$S = e^{-\gamma(1-S)}$$
 .....(1)

透明なもので方向性が著しく、すべて134~136℃で変形 収縮し,75 Mrep 照射のものも収縮が著しかった。したが って適当に方向性を持った照射フィルムを電気機器の絶 縁または包装用に用いて変形温度まで加熱すれば空隙の ないぴったりしたものができるわけである。これは照射 ポリエチレンフィルムの著しい特長の一つである(17)。 照射ポリエチレンはゾルとゲルの混合物と考えられるの で流動点は測定法によりかなり差異が生ずる場合のある ことが考えられる。それで、これらの試料について少量 の荷重をかけて試料が切断する温度を測定したところ, 照射量の少ない部分はいくぶん高く観測され、照射量の 多い部分はほとんど差異がなかった。 Chapiro 氏<sup>(18)</sup>は この方法と類似の方法で流動点を測定しているが、 1.41 Mrep以上 γ線を照射したものは 300°Cまで加熱して も切断しないことを報告している。われわれの場合は空 気浴中で加熱したが、Chapiro 氏は水銀浴を使用してい るので、この違いの原因として酸素の影響が考えられる が, 高温における照射ポリエチレンの引張強さは非常に 小さいので荷重など実験条件の差がかなり大きく影響す るであろうから,さらに検討の必要があると考えられる。 また第1図で流動点が急激に立ち上っている部分は2 ~4 Mrepで、あとに述べるように溶解度から求めたゲル 点がほぼこの範囲にあることは興味深い。なおこの図か ら未照射物の流動点は主として結晶性により支配される が,照射物ではおもに架橋度によるものと思われる。

なる関係を導いた。のち Charlesby氏<sup>(20)</sup> はポアソン分 布(重合度を  $P \ge f$  る  $P \ge A_0 | P_0 \cdot \exp(-P/P_0)$  なる 場合の分布,  $A_0$  は全分子数,  $P_0$  は平均重合度) をして いる場合,

 $S(1+\gamma-\gamma S)^2=1$  ......(2) なる関係を導いた。かれはさらに架橋とともに主鎖の切 断も照射量に比例して起る場合を考え,真の架橋指数  $\gamma'$ は切断が起らないと考えた場合の架橋指数 $\gamma$ に対して

 $\gamma' = \gamma / (1 + f\gamma) \quad \dots \quad (3)$ なる関係にあることを導いた。fは一定の照射によって 作られる架橋単位 (-CH-) に対する切断の割合である。 Charlesby 氏は原子炉内で照射されたポリエチレンにつ いて $f = 0.3 \sim 0.4$ なる値を得ている。第3図はMarlex-50の真空中照射試料について実測されたゲル量と照射量 との関係を示したものである。実測値は f=0.7 の曲線 に大体のっている。 Petrothene 210 についての実測値 も多少ばらついているが同様に f=0.7 の曲線付近にあ る。第4図はPetrothene 210 で200 mmHgの酸素を封 入して照射した場合でf = 1.2となっている。Alexander 氏ら(21) は高圧電子線を酸素中でポリエチレンに照射し f>1.0なる結果を得ている。架橋単位2個で1個の架橋 を作るから f=0.7 ということは架橋1個できるごとに 1.4 個の切断が生ずることを意味する。しかしこのよう にして得られた切断の数は分子量分布が実際にはポアソ ン分布をしていないため疑問である。Pearson氏<sup>(22)</sup>も注

----- 5 -----



絶縁材料特集号 第2集

日立評論 別冊第31号



(曲線は Charlesby の理論曲線,○印は実測値)
第3図 Marlex-50のゲル量と照射量の関係



第4表 γ線照射 Petrothene 210の容積膨潤比(80°C)

試料番号	照射量 (M <sub>rep</sub> )	容積膨潤比 (Qv)	容積分率 (v <sub>2</sub> )	架橋間分子量 $(\overline{M}_c \times 10^4)$
V-1	1.0			
V-2	1.8	170	0.006	286
V-3	3.9	64	0.016	53
V-4	18	14	0.071	4.86
V-5	4.2	43	0.023	34.8
V-6	8.7	19.3	0.052	8.26
V-7	21	10.4	0.096	3.2
V-8	81	5.8	0.173	1.02
Irrathene 201		11	0.091	

第5表 γ線照射 Marlex-50 の容積膨潤比 (110°C)

試料番号	照射量 (Mrep)	容積膨潤比 $(Q_v)$	容積分率 (v2)	$\overline{M}_c  imes 10^4$	架橋数 c×105モル	Gel
MV-1	5.5	84	0.012	102	8.18	15.4
MV-2	10	26	0.038	14.4	8.48	8.8
MV-3	21	13	0.077	4.3	9.30	4.6
MV-4	75	8.7	0.11	2.3	10.31	1.4

を用いると *Get* は 4.9 となる。これらの値は水素生成の *G*値と比べてもかなり大きい値である。これはポアソン 分布を仮定することの不適当であることを示すものと考 えられる。Tung 氏によれば Marlex-50 では  $M_n/M_w =$ 0.164 となるが、ポアソン分布の場合はこの比が 0.5にな るはずである。主鎖の切断が無視できるとすれば、任意 の分子量分布の場合についてゲル点では  $\gamma = M_n/M_w$  で あるから、これから *Get* を求めると 1.61 となる。なお Busse氏ら<sup>(24)</sup>の指摘するように *Get* は *Mw* の値により左 右されるからその正確な測定が問題となる。

意しているように分子量分布が溶解度曲線に対して切断 と同様の影響を持つことがわかっており,われわれも分 子量分布を考慮することにより,切断を考えないで実験 結果を一応説明することができたがこれについては5章 で述べる。

さらにCharlesby氏の理論によれば架橋指数 $\gamma$ (切断の ある場合は $\gamma'$ )はゲルのできはじめるゲル点では $M_n/M_w$ であり、ポアソン分布の場合にはこの値は $\frac{1}{2}$ となる。切 断が増すにつれてゲル点の $\gamma$ は(3)式により大きくな る。f=0.7のときゲル点では $\gamma=0.77$ になるからゲル点 に対応する照射量から吸収エネルギー 100 eV あたりの 架橋の数 $G_{cl}$ は次のようにして求められる。

$$G_{cl} = \frac{(\gamma/2) \times 6.03 \times 10^{23} \times 100}{r \times 5.8 \times 10^{13} \times M_n} \dots (4)$$

ここでrは照射量(rep)である。 Marlex-50 ではゲル 点に対応する照射量 4.3 M<sub>rep</sub>,  $M_n$  として Tung氏<sup>(23)</sup>の 値 12,300 を用いると $G_{cl}$  として 7.5が得られ, Petrothene 210 では同様に照射量として 2.7 M<sub>rep</sub>,  $M_n$  として 30,000

#### 4.4 容積膨潤比

ゲル量の測定と同時に容積膨潤比 Qv を次式より求めた。

 $Q_v = 1 + \rho_1 W_s / \rho_0 W_1 - \rho_1 / \rho_0 = 1 / v_2 \dots (5)$ 

ここで W<sub>s</sub>, W<sub>1</sub>はゲルの膨潤時および乾燥時の目方, ρ<sub>0</sub>, ρ<sub>1</sub>は測定温度における溶媒およびゲルの比重, v<sub>2</sub>は 膨潤試料中の高分子の容積分率である。測定結果を**第4** 表および**第5**表に示す。

Flory 氏<sup>(25)</sup>によれば膨潤の実験から架橋間分子量 *M*<sub>c</sub> が次式から求められる。結果を 第4,5 表に示す。

 $M_c = \rho_1 V_0 (v_2^{1/3} - v_2/2)/(1/2 - \mu)v_2^2$  .....(6) ここで $V_0$ は測定温度におけるキシレンの分子容,  $\mu$ は 溶媒と溶質の相互作用に関係する量でこの場合 0.33とし た。架橋の効率  $G_{cl}$ はゲル点から求められたが,  $M_c$ か らも求めることができる。すなわち試料 1 グラムあたり の架橋の数を c,  $M_{ng}$ をゲルの最初の数平均分子量とし, gを分子のからみあい, あるいは分子内架橋を補正する 因子とすれば次の関係が得られる。

 $1/2\overline{M}_{c} = g(c-1/M_{ng})$  .....(7) g=1と仮定し, Marlex-50 について  $M_{ng}$  として全体





の数平均分子量  $M_n = 12,300$  を使うとcおよび  $G_{el}$  は 第 5表 のようになる。照射量の少ないところの  $G_{el}$ の値は 非常に大きくゲル点の  $G_{el}$ の値からみて不合理である。 これは $M_{ng}$ の代りに試料全体の数平均分子量をとったた めで、ゲル量の少ないところでは比較的大きい分子量の ものからゲルになりやすいため、 $M_{ng}$ は $M_n$ よりかなり 大きいことが予想される。 $M_n$ が大きくなれば当然 $G_{el}$ の 値は小さくなる。ゲル量が多くなるにつれて $M_{ng}$ はしだ いに  $M_n$ に近づく。したがって、第5表の  $G_{el}$ の値では ゲル量の多いところ、すなわち照射量の多いところの値 が比較的信頼できるように思われる。このように $M_{ng}$ は ゲル分率に関係するほか分子量分布にもよる。これにつ いては5章で述べる。



#### 4.5 引張り試験およびゴム弾性

照射 Petrothene 210の幅 13 mm のテープを長さと直 角方向に幅 4 mm に切り取ったものを試片とし、4 mm/ min の一定速度で上方に引張り、試料にかかる力を抵抗 線ひずみ計で電圧にかえ、自動平衡形記録電圧計で記録 させた。 第5 図 は張力~伸び曲線を示し、縦軸には引 張強さを単位として引張力を表わした。 120°C では結晶 部分が存在しないため、ゴム状物質特有の逆 S 字形を示 し、未処理の試料は110°C以上では少しの張力もささえな い。真空中照射試料の伸びと照射量の関係を第6 図に、 引張強さと温度の関係を第7 図に示す。未照射のもので は融点 110°C以上で引張強さを示さないが、81 Mrep 照射 のものは 140°C でもかなりの引張強さを持っている。

架橋の数は膨潤比の測定から求められることは上に述 べたが、ゴム状物質の張力 τ と伸長率αからも網目を作 っていて張力に有効な鎖、すなわち架橋の数 Σが求ま る。試料中に張力に有効でないゾルを含む場合は、これ を膨潤したゲルと考えると

 $\tau = R_g \Sigma v_2^{1/3} (\alpha - 1/\alpha^2)$  .....(8) なる関係が得られる。照射ポリエチレンが高温では結晶

#### 1 2 3 4 5 6 7 伸長率(d)

# 第8図 照射 Petrothene 210の引張力と伸長率の関係(ゴム弾性理論との比較)



第9図 照射 Petrothene 210 の膨潤および張 力から求めた有効な架橋間分子量 *M*cの比較

性を失ってゴム弾性を示すことは上に述べたが,第8図 は真空中 21 M<sub>rep</sub>照射した Petrothene 210 の 140°C に おける張力と伸長率の関係を示したものである。点線は  $\overline{\nu}=5.1\times10^{-5}N$  (Nはアボガドロ数)としたときの理論値 である。伸長率があまり大きくないところでは実験値と 理論値はかなりよく一致している。ここに求めたシは分 子が十分大きければ架橋の数の2倍になるが,有効な架

7 \_\_\_\_\_

絶縁材料特集号 第2集

日立評論 別冊第31号



第10図 Marlex-50 の赤外線吸収スペクトル 10~12μの照射による変化

橋間の分子量 $\overline{M_c}$ に比べて十分大きくなければ

 $\overline{\nu}/2 = g(c - \rho/M_{ng})$  .....(9) となる<sup>(26)</sup>。したがってこの場合の架橋間分子量は $\overline{M}_c = \rho/\overline{\nu}$ として求められる。**第9**図は膨潤から求めた $\overline{M}_c$ と



第11図 Marlex-50 の11.0μのビニル基およ び 10.35μのトランスビニレン結合の吸収の γ線照射量による変化

レン Petrothene 210の測定値も示されているが, トラ ンス・ビニレン基の生成は両者ほとんど同じであった。 なお, Dole 氏ら<sup>(15)</sup>は照射により環化も生ずることを赤 外線分析から報告している。

低密度ポリエチレンではビニリデン基, Marlex-50

開かってして、あられる。第9図は膨固から来めた Mc と 張力から得たものとを比較したものであるが、両者はか なりよく一致している。架橋の数 c から Gcl を求めるこ とができるが、 Mng、g の仮定が含まれたものとなる。 Lawton氏ら<sup>(27)</sup>はこのような方法でいろいろの分子量の ポリエチレンに電子線を照射した場合生ずる架橋の数を 計算している。しかし、このようにして求めた架橋の数 はゲルについてのもので膨潤の場合と同様の補正を要す る。

# 4.6 赤外線分析よりみた構造変化

Miller 氏ら<sup>(13)</sup>は低密度ポリエチレン DYNH に高圧電 子線を照射した場合の二重結合の変化を赤外線分析より 追跡し,ビニリデン基は15 Mrep,ビニル基は50 Mrepの 照射で消失し,逆にトランス・ビニレン形は照射ととも に増大することを報告した。原子炉内,7線照射などで も同様のことが報告されている<sup>(12)(28)</sup>。当研究室におい ても Marlex-50の7線照射試料の赤外線スペクトルを検 討したが,10~12µ部分を第10 図に示す。未照射試料 は11.0µにビニル基の深い吸収があり,10.1µにもビニ ,ル基の吸収がみられる。11.25µのビニリデン形の吸収 はほとんどみられない(低密度ポリエチレンでは二重結 合のうちビニリデン形が最も多く60~68%に達する)。 7線照射とともにビニル基の吸収は急激に減少し,10.35µ のトランス・ビニレン形の吸収が増大している。第11 図 にこの模様を示す。同図には参考のため低密度ポリエチ ではビニル基の減少が架橋反応と関係があると Dole 氏 ら<sup>(29)</sup>は考えており, Pearson 氏<sup>(22)</sup>はトランス・ビニレ ン基が架橋反応の中間段階に関与しているとの構想を提 出している。 Charlesby 氏<sup>(30)</sup>は二重結合を持った多く の長鎖不飽和炭化水素について実験を行い,中央に二重 結合のある化合物はパラフィンとほとんど架橋効率に差 がないが,端に二重結合のあるものはパラフィンに比べ てかなり架橋を作るに要するエネルギーが小さくなって いることを明らかにした。したがって,二重結合が架橋 反応にあずかり,架橋を容易にしていることが予想され るが,架橋反応の機構についてはまだ明らかでない部分 が多く確認されるに至っていない。

#### 5. 分子量分布の影響<sup>(31)</sup>

前に述べたように Charlesby 氏はポリエチレンの照射 に伴う溶解度の減少を、ポリエチレンの分子量分布がポ アソン分布であると仮定して理論的に解析した。しか し、実際にはポリエチレンの分子量分布はポアソン分布 とはかなり異なっていることが Tung 氏の分子量分別の 実験によって明らかにされているので、架橋効率などの 値については正しい分子量分布を考慮に入れた再検討が 必要になる。以下この点について考察しよう。

重合度が $u \ge u + du$ の間にある分子の数をn(u) duとすれば, 関数n(u)は重合度分布関数を表わすが, n(u)が単調減少関数である場合,一般に次式のように表

— 8 —

わすことができる。

74

$$n(u) = A_0 \sum_i \frac{f_i}{\tau_i} e^{-u/\tau_i}, \quad \sum f_i = 1 \dots \dots (10)$$

ここに  $A_0$  は単位体積中の分子数,  $f_i$ ,  $\tau_i$  は常数である。 (10) 式の最も簡単な場合として二つのポアソン分 布の重ね合せ

を考えれば、これは常数 $f_1$ 、 $\tau_1$ 、 $\tau_2$ を適当に選ぶことに よって単純なポアソン分布に比べてかなりすそを広くひ いた分布を表わすことができる。(11)式を用いて数平 均分子量  $M_n$ 、重量平均分子量  $M_w$  および Z 平均分子量  $M_z$ を計算すれば、

$$\begin{split} M_{n} &= M_{0} [f_{1}\tau_{1} + (1 - f_{1})\tau_{2}] \quad \dots \dots \dots \dots \dots (12) \\ M_{w} &= 2M_{0} [f_{1}\tau_{1}^{2} + (1 - f_{1})\tau_{2}^{2}] / \\ & [f_{1}\tau_{1} + (1 - f_{1})\tau_{2}] \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots (13) \\ M_{z} &= 3M_{0} [f_{1}\tau_{1}^{3} + (1 - f_{1})\tau_{2}^{3}] / \end{split}$$

 $[f_1\tau_1^2 + (1-f_1)\tau_2^2]$  .....(14)

となる。ここに  $M_0$  はモノマーの分子量でポリエチレン では14である。Tung 氏の実験データーによれば, 高密度 ポリエチレン Marlex-50の場合 $M_n$ =6,450,  $M_w$ =89,400,

第6表	Marlex-50	)の架橋効率の	補正值
11 - 1	ATACCE I OIL OIL		1111 11 11

照 射 量 (Mrep)	$G_{cl}$	
5.5	0.93	
10	0.81	
21	0.88	
75	0.87	

とのずれを分子の切断の影響に帰したわけであるが,分 子量分布の広がりを正しく考慮に入れれば,図のよう に実測値とよく一致し,切断効果を考える必要がなくな る。 $M_n=12,300, M_w=74,900, M_z=220,000$ を用いた 場合には理論曲線は実測値といくらかずれるが,それで も単一のポアソン分布の場合よりもはるかに実測値に近 い曲線が得られる。現在のところ測定点の数も少なく, 重合度分別の精度も十分とはいえないので,以上の結果 からただちに照射による切断がまったくないとは断言で きないが,少なくともポアソン分布を用いた理論曲線か らのずれを全部切断の効果と考えた Charlesby 氏の結論 は改められなければならない。

次に容積膨潤比から架橋間分子量  $M_c$ を求め、それから架橋の数 c を求める(7)式において、4.4節ではゲルの数平均分子量  $M_{ng}$  の代りに最初の全体の数平均分子量  $M_n$ を用いたが、前にも述べたようにゲル点の近くでは  $M_{ng}$ は  $M_n$  よりかなり大きいはずである。 $M_{ng}$ は分子量分布が与えられれば Charlesby の理論により次式から計算することができる。

 $M_z$ =220,000 および  $M_n$ =12,300,  $M_w$ =74,900,  $M_z$ = 220,000 の2組の値が得られるが, いま試みに前者の値 を用い(12), (13), (14)式により  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $f_1$ を求めれ ば  $\tau_1$ =189,  $\tau_2$ =5,230,  $f_1$ =0.946 となる。

上に得た常数値を持つ重合度分布関数 n(u) を用い, Charlesby 氏のゲル化の理論に従って,架橋数と生成ゲ ルの重量分率 g との関係を求めることができる。第12 図に Marlex-50 に対する架橋係数 (=重量平均分子あた りの架橋数) るとゲルの重量分率g との関係の実測値お よび理論曲線を示す。〇印は実測値であり,点線は単一 のポアソン分布を用いた理論曲線,実線は二つのポアソ ン分布の重ね合せ (11) 式を用いた理論曲線である。 Charlesby 氏はポアソン分布を用いた理論曲線と実測値



 ○印: Marlex-50のγ線照射による実測値
 ……: ポアソン形重合度分布の場合の理論曲線
 —: ポアソン分布の重ね合せの場合の理論曲線
 第12図 ゲルの重量分率 g と架橋係数 δ との 間の関係



ここで $u_2 = M_w/M_0$ である。したがってこの $M_{ng}$ の値 から架橋の数c c c(7)式により算出し、さらにこれから 架橋効率  $G_{cl}$ を計算すれば第6表のようになる。

#### 6.酸素の影響

酸素の存在は架橋の効率を著しく悪くすることはすで に述べたが、これは放射線により生じたラジカルが架橋 を作る前に酸素と反応してしまうためと考えられる。第 13 図 は厚さ 0.08 mm の Petrothene フィルムを常温, 1 気圧の酸素圧下で線量強度 1.65×10<sup>4</sup>~7.9×10<sup>4</sup> rep/h で r 線を照射した場合の酸素吸収量と照射時間の関係を 示したものである<sup>(32)</sup>。酸素吸収量が増すにつれていく ぶん自触媒的に吸収量が増大し、第14 図 に示すように 同じ照射量に対しては、線量強度の弱いほど酸素吸収の 効率が良くなっている。いいかえれば線量強度の弱いほ ど酸素の影響は著しいわけである。このような条件で照 射された試料の照射量と流動点を第7表に示す。20Mrep

絶縁材料特集号 第2集 日立評論 別冊第31号



第13図 厚さ 0.08 mm の Petrothene 210 の γ線 照射による酸素吸収量と照射時間との関係



第14図 0.08 mm 厚の Petrothene 210 の酸素吸収 量と照射量の関係に及ぼす線量強度の影響

第7表 酸素中照射 Petrothene 210 の流動点

るものと思われる。これらについて Magat氏の講演(36) は参考になる。

ポリエチレンの架橋による品質改善には少なくも 10 Mrep 以上の照射が必要と考えられるので、さらに少 量の照射で架橋を行う架橋促進剤の研究が要望される が、われわれは塩化メチル、アセトンでは一応負の結果 を得た。Sequoia 社は Stanford Research Institute と 共同で添加剤の10,000の組合せを試験し、有効なものを 発見したが,結局効果のあったのは最初のグループであ った由である(5)。この添加剤が架橋促進剤か否かは不明 であるが, ゴム類の放射線加硫に対して有効な架橋促進 剤は数種報告されている(37)。

#### 7. 架橋に及ぼす結晶度の影響

低密度ポリエチレンと Marlex-50 では γ線を照射し た場合前者のほうがいくぶん見かけの架橋の効率が良い ことを前に述べたが,従来架橋は主として無晶質の部分 で行われ,結晶度の低いほど効率が良いといわれている が,架橋の効率は結晶度によらないという報告も提出さ れている(3)(38)。

われわれはファンデグラフ装置により1MeV, 30 µA で約10Mrep 空気中で照射した各種ポリエチレン膜(厚

番号	線量強度 (rep/h)	照射量 (Mrep)	流動点 (℃)	変 形 点 (℃)
No. 1	7.9×104	5.4	109~110	105
No. 2	$7.9 \times 10^{4}$	13.3	107~109	105
No. 3	$7.9 \times 10^{4}$	26.6	108~110	105
No. 4	7.9×104	29.8	$112 \sim 116$	105
No. 5	$3.85 \times 10^{4}$	15.9	108~110	105
No. 6	1.65×104	11.4	110~114	105
未照射	80000000		107~110	105

程度の照射でも流動点はほとんど上昇せず, No.4を熱 キシレンに溶解した場合ゲル量はわずか1.6%であった。 したがってこの程度の線量強度では酸素が十分存在すれ ば放射線により生ずるラジカルはほとんどすべて酸素と 結合するものと考えられる。酸素はラジカルと非常に結 合しやすく、N2中にわずか1%の酸素が存在してもか なり影響があるといわれる(21)。 試料が薄いほど、線量 の弱いほど影響は著しい。 Pierre 氏 ら(33) も試料が薄 く線量の弱い場合はゲルがまったく生じない場合のある ことを報告している。 Bach 氏<sup>(34)</sup> によればヘプタン, イソオクタンなど炭化水素は酸素の存在下で放射線によ ってかなり収率良くパーオキサイドを生成する。また Chapiro氏(35)が報告しているように空気中でγ線を照射 されたポリエチレンはアクリロニトリルなど重合性モノ マーをグラフト重合することから、ポリエチレンには ? 線照射によりかなりのパーオキサイド結合が生成してい さ0.1~0.2mm)のゲル量を測定し第8表の結果を得た。

また, 原子力研究所の原子炉内で真空中照射した結果 は第9表のとおりである。

第9表中,Wは1週間,4Wは4週間照射で,照射量 rep は同封したポリメチルメタクリレートの溶液粘度か ら推定したものである。適確に推定することはなかなか 困難であり、かなり誤差が含まれていると思うが、60Co

第8表 高圧電子線照射による各種ポリエチレ ンのゲル量

Hizex 6,600 (Ziegler法)	7.3
Hizex 6,200 (Ziegler法)	0
Hizex 5,500 (Ziegler法)	2.5
Fortiflex (Phillips法)	18.2
Marlex-50 (Phillips法)	0
Hi D 156 (中密度)	4.6
Hi D 154 (中密度)	33.3
DYNH	43.7
Polythene 511 D	48.1

第9表	原子炉	内照射名	・種ポリ	エチレ	ンの	ゲル量
-----	-----	------	------	-----	----	-----

	ゲール	(%)
ポリエチレン名	W (3.2×107 rep)	4 W (1.9×10 <sup>8</sup> rep)
Hifax 14005 (Ziegler 法)	18.5	43.5
Marlex-50 (Phillip法)	34.4	51.7
Hi D 154 (中 密 度)	35.5	57.0
Polythene 511 D	59.0	81.8

に比べて多少架橋能率が悪い。

W

電子線照射では低密度ポリエチレンと高密度ポリエチ レンでは多少実験に精度を欠くが、架橋効果に著しい差 が生じており, 原子炉内照射でもかなり架橋効果に差が 観測された。照射後これら試料の赤外線吸収スペクトル をとったところ,低密度ポリエチレンでは 5.8μのケト ンによる吸収はごくわずかであったが、高密度ポリエチ レンではかなり著しい吸収を示し,酸素の吸収されたこ とを示した。なお以前に Marlex-50 を γ線で75 Mrep 照 射した試料の赤外線吸収スペクトルをとったところ同様 5.8µに若干吸収を示していることが観測されたが、低 密度ポリエチレンでは観測されなかった。最近 Lawton 氏ら<sup>(39)</sup>は高圧電子線を -200~+200°C にわたって低密 度および高密度ポリエチレンに照射して架橋効果を調べ ているが、その結果を第15図に示す。常温付近では 低密度ポリエチレンのほうが架橋の効率が著しく良いこ とがわかる。真空常温で照射した Marlex-50 をそのま ま加熱するとゲル量は著しく増加し,また照射後室中に 取り出し一定時間ごとに赤外線吸収スペクトルをとると 第16図に示すように Marlex-50 では 400時間後もな お 5.8µ のケトンの吸収が増加している。これらの現象 は結晶内に生じたラジカルは動きにくく, 凍結されてい 結果も同様にして大体説明できる。常温における低密度 ポリエチレンと高密度ポリエチレンの架橋効率の差は 49キュリーの<sup>60</sup>Co の7線より原子炉内のほうが著し く, Van de Graaff 装置ではさらに著しくなってい る。すなわち線量強度の大きいほど効率の差は著しい。 これは線量強度の弱い場合は真空中に長くおかれるため に徐々に架橋するが,線量強度の強い場合は短い照射時 間後ただちに空中に取り出されるため,空気中の酸素と 徐々に結合して架橋の能力を失う部分も多いためと考え られる。

Waddington 氏<sup>(40)</sup>は 4 MeV の Orthotron<sup>(41)</sup> を用い て高圧電子線を照射し、30°Cで100 Mrad 照射した試料の 膨潤,ゴム弾性の測定を行い,架橋の効率は低密度ポリ エチレンも高密度ポリエチレンもほとんど差がないこと を報告しているが,かれの測定値からゲルのできはじま るゲル点に対応する照射量は Alkathene G2 ではほぼ 1 Mrad, Alkathene HD (比重 0.94) では 3.5 Mrad, Marlex-50 では 5.7, Hostalen HD では 10 Mrad とな っている。 さらに 10 Mrad におけるゲル量を求めると Alkathene G 2 1273%, Alkathene HD12 50%, Marlex-50は30%, Hostalen HD は3%となり, われわれの結果 と大体傾向を同じくしている。Waddington はこれらの 原因が分子量の差によるであろうとしているが、同時に 結晶度の差による影響も非常に大きいことを考慮する必 要があると思われる。しかし, 原研の 60Co 1 万キュリー の照射において DYNJ と Hizex 7,000 ではHizexのほう がゲル量がいくぶん大きい結果も報告されている(42)(こ の場合照射により試料の温度がかなり上昇するといわれ ているので温度効果も大きいと考えられる)ので、結晶 度の差とともに分子量およびその分布も十分考慮し詳細 に再検討することが望ましいと考えられる。

# るためと説明されているが,上に示したわれわれの実験



第15図 低密度ポリエチレンおよび Marlex-50の ゲル量に及ぼす照射温度の影響





#### 8. グラフト重合

有機高分子の放射線加工のうちで、ポリエチレンの架 橋とともに最も将来性があると考えられている分野で、 これに関する研究も日を追って盛んになっている。グラ フトというのはつぎ木の意味で、放射線により幹となる 高分子、たとえばポリエチレンにラジカルが生ずるので 重合性モノマーが共存すれば、ここから重合が始まり分 枝ができる。このように放射線を用いてグラフト重合を 行うには大別して次の3方法がある。(1)ポリエチレ ンとモノマーを共存させて放射線を照射する。(2)ポ リエチレンを真空中で、しかもなるべく低温で照射し、 照射後モノマーにつけるか、モノマーの蒸気にさらす。 (3)空気中または酸素中でポリエチレンに照射し、ポリ エチレンにパーオキサイド結合を作り、これをモノマー 中で分解させる。これらの方法をもう少し詳しく説明す

絶縁材料特集号 第2集

日立評論 別冊第31号

第	10	表	ポリ	エチ	V	2	Ø	グ	ラ	フ	ト	重	合	Ø	例	

ポリマー	グラフトした モノマー	線量強度 (10 <sup>5</sup> rep/h)	照射量 (10 <sup>5</sup> rep)	試料の 厚さ (mils)	グラフ ト量 (%)
ポリエチレン	アクリル酸	3	0.75	3	37.0
ポリエチレン	アクリロニトリル 28%ギメチルフォ ルムアミド溶液	3	9.0	4	16.6
ポリエチレン	メチルメタクリレ	1.6	0.4	4	29.5
ポリエチレン	スチレン	2.75	27.0	10	44.5
ポリエチレン	ビニルカルバゾー ル 1.5M キシレン 溶液	2.5	47.5	10	20.0
ポリエチレン	4-ビニルピリジン (未蒸溜)	1.72	1.72	4	33.3
ポリエチレン	ビニルステアレー ト60%ベンゼン溶 液		28.0	-	7.2

ると、(1)の方法ではポリエチレンおよびモノマーから ラジカルと結合しやすい酸素を除いておくことが望まし く、モノマー蒸気中またはモノマーにつけてグラフト重 合させることができる。しかしこの場合、グラフトポリ マーと同時にモノマーだけのポリマーであるホモポリマ ーも生成する。したがってポリマーがラジカル化しやす く、モノマーがラジカル化しにくいが、重合しやすいとき は問題はなくスチレンはこの例である。しかし、逆の場 合は(2)の方法が考えられる。モノマーがポリエチレン をほとんど膨潤しないときはおもに表面グラフト重合が 起り、モノマーが十分膨潤するときは均一グラフトポリ マーを生ずる。また適当な溶媒の使用も有効な場合があ る。(2)の方法はポリエチレンを真空中で照射し、しか もなるべく低温に保ってラジカルの消耗を防ぎ、照射後 モノマーにふれさせるのであるが、ラジカルの寿命から 考えて、これを凍結しやすい高密度ポリエチレンのほう が低密度ポリエチレンより、この点では有利である。(3) の空気中照射の方法は Chapiro 氏らにより見いだされた もので、最近わが国でも特許が公告された<sup>(43)</sup>。 その後、 Chapiro 氏は空気中で照射したポリエチレンのグラフト 重合について詳細に研究している<sup>(44)</sup>。

次に参考のためにポリエチレンにグラフト重合した例 を第10表にあげる<sup>(45)</sup>。

われわれの研究室においても(1)の方法によりポリエ チレンにアクリロニトリルおよびスチレンをグラフト重 合する実験を行ったので次にその結果について述べる。

#### 8.1 グラフト重合速度

第17図は厚さ0.085mmのPetrothene 210のフィル ムにアクリロニトリルを気相(常温飽和蒸気圧)でィ線 照射によりグラフト重合した場合のグラフト量と照射時 間の関係を示したものであるが、照射時間に対して著し く加速的になっている。液相重合の場合も、ほとんど同 じ結果が得られた。これはポリエチレンよりポリアクリ ロニトリルのほうがラジカル生成のG値が大きいために グラフトしたポリアクリロニトリルの量が増すとこの分 枝にさらにグラフト重合が容易に起るためと考えられ る。第18図にグラフト量と照射量の関係を示したが、 線量強度の弱いほどグラフト重合の効率が良くなってい る。そして1×10<sup>4</sup> rep/h の線量強度で 0.6Mrep程度の照 射でグラフト量50%程度に達している。第19図は同じ くスチレンを気相でグラフト重合した場合のグラフト量 と照射時間の関係を示したものである。最初、グラフト 量は加速的に増大しているが、のちには速度が鈍ってい



第17図 厚さ0.085mmのPetrothene
 210 に対するアクリロニトリルのグ
 ラフト量と照射時間の関係

第18図 ポリエチレン-アクリロニト
 リル気相グラフト重合におけるグラ
 フト量と照射量の関係

 (0.085 mm 厚の Petrothene 210)

第19図 ポリエチレン-スチレン気
 相グラフト重合のグラフト量と照
 射時間の関係 (ポリエチレンは
 0.085 mm 厚の Petrothene 210)





第23図 ポリエチレン-スチレングラ
 フトポリマーの流動点とグラフト量
 の関係(ポリエチレンは 0.085 mm厚
 の Petrothene 210)



第24図 ポリエチレン-アクリロニ
 トリルグラフトポリマーの流動点
 (荷重式による)とグラフト量の関係(ポリエチレンは 0.085mm 厚の
 Petrothene 210)



第25図 ポリエチレン-アクリロニ
トリルグラフトポリマーのグラフ
ト量と抗張力の関係,●○は試料
膜の上下の部分の値,下のほうが
照射量少し多し(ポリエチレンは
0.085 mm 厚の Petrothene 210)

る。これはポリスチレンのラジカル生成のG値が小さい ことと関連があるものと思われる。この場合も線量強度 の弱いほどグラフトの効率は良くなっている。スチレン の場合同じ線量強度で0.2 Mrepの照射でグラフト量 50% を越えており,アクリロニトリルよりはるかにグラフト しやすいことを示している。

8.2 グラフトポリマーのゲル量および膨潤比

第20図はポリエチレン-アクリロニトリルグラフトポ リマーについて、100℃の熱キシレン中で10時間加熱抽出 後残った不溶部分とグラフト量の関係を示している。あ とで述べるようにこの不溶部分をゲルと考えると、50% のグラフト量でゲル量は70%を越えており、これに要す る照射量は 1.7×10<sup>4</sup> rep/h の強度で 0.7 Mrep 程度であ る。ポリエチレンのみの架橋により、この程度のゲル量 に達するには第2図から 20 Mrep 程度必要となる。第21 図は同じグラフトポリマーの100°Cの熱キシレン中の重 量膨潤比とグラフト量の関係を示している。グラフト量 の増加とともに急激に膨潤比は減少している。 第22 図 は最初のポリエチレンに対してグラフトされたポリエチ レンの割合を示したもので,この図からこの実験条件で はグラフト量がいくら増しても35%程度の内部に包まれ たポリエチレンはグラフト重合にあずからないことが予 想される。これに対し,スチレングラフトポリマーはす べて熱キシレンに溶解しまったく不溶解物を残さなかっ た。したがって,アクリロニトリルの場合はグラフトと して生長しているアクリロニトリルラジカル同志結合し て架橋を作っているのではないかと考えられるが,しか しポリアクリロニトリルがキシレンに対して貧溶媒であ るせいかも知れず,これだけでは結論しにくいが,次に述 べる弾性率の測定結果そのほかからやはり架橋を作って

----- 13 -----

絶縁材料特集号 第2集

日立評論 別冊第31号







第27図 ポリエチレン-アクリロ ニトリルグラフトポリマーの弾 性率の温度による変化(点線は 熱処理したもの)



第28図 ポリエチレン-スチレン グラフトポリマーの張力~伸び 特性(ポリエチレンは 0.085 mm 厚の Petrothene 210)

いると考えてよさそうである。

8.3 グラフトポリマーの流動点

第23図はポリエチレン-スチレングラフトポリマー の流動点とグラフト量の関係を示している。●印は顕 微鏡下に形のくずれて流れる温度であり、×印は少量の 荷重をかけた場合試片が伸びて切断する温度である。ポ リスチレン膜について同様測定したところ前者の三田村 式では 175~187°C で、 グラフトポリマーの漸近温度よ りいくぶん低く,荷重式では148~151℃で80% グラフ トポリマーとほとんど同じであった。この原因を考える と、 少量のグラフトでは荷重がかからないときはかろう じて形を保っていても荷重がかかると, それをささえき れないためにこのような現象が観測されたものと思われ る。アクリロニトリルグラフトポリマーではわずかグラ フトしても三田村式測定器では形の変化が明らかでなく 測定が困難であったが、荷重式では第24図に示すよう にグラフト量の増加とともに急速に流動点は上昇し,50 %近くなると240℃でも切断しなくなった。なお、この 場合130°Cあたりよりいくぶん着色しはじめ温度上昇と ともに著しくなる。



8.4 グラフトポリマーの機械的性質

第25図はポリエチレン-アクリロニトリルグラフト ポリマー(気相重合)のグラフト量と引張強さの関係を, 第26図はグラフト量と伸びの関係を示している。第27 図は弾性率の温度変化を示しているが,グラフト量23% 以下の試料ではグラフトしないものとの差がほとんど認 められなかった。グラフトポリマーの弾性率が110°C以 上で,ほぼ一定の値を保つ傾向はこのものに架橋構造の 存在することを示しているように思われる。篠原氏ら<sup>(46)</sup> はポリエチレン-アクリロニトリルグラフトポリマーの 粘弾性およびゴム弾性的研究を行い,約30個のアクリロ ニトリル単位がポリエチレンの分子間を架橋していると 第29図 ポリエチレン-スチレングラフトポ リマーのグラフト量と伸びの関係 (×印は Petrothene 210, および Marlex-50の厚み はともに 0.085 mm)

述べている。なお照射によって架橋したポリエチレンの 弾性率は熱処理によって低下する<sup>(3)(47)</sup>が, このグラフ トポリマーでは逆に増加する。ポリエチレンの場合には 架橋によって結晶化が妨げられるためであるが,いまの 場合グラフトが比較的表面で起るため,内部の結晶化に 影響が少ない,熱処理によってポリアクリロニトリルが より緻密な構造をとる,新しい架橋を生ずるなど考えら れるが,これらの点はさらにグラフトポリマーの構造を 明らかにして検討しなければならない。次にスチレング ラフトポリマーの引張強さと伸びの関係を 第28 図 に示 す。この場合もグラフト量とともに引張強さは増大し た。85%グラフトしたものではポリスチレンに特性が近 くなり,引張強さが非常に増すが,ポリスチレンが約10 %の伸びで破断するのに比べて非常に大きい伸びを保っ ていることがわかる。

次に, スチレンのグラフト重合による試料膜の伸び

射 線 加 T ポ 放 IJ 0 チ 1 I

ジビニルベンゼングラフトポリ

マーの重量膨潤比とグラフト量

の関係に及ぼすDVBの効果

(ポリエチレンは 0.085 mm厚の

300

200

100

3

5

ŧ

D.V.B 0%.

D.V.B 0 %.

D.V.B 5

ジビニルベンゼングラフトポリ

マーの抗張力および伸びとグラ

フト量との関係に及ぼす DVB

の添加量の影響(ポリエチレン

は 0.085mm 厚の Alathon 10)

100

Alathon 10)



第 30 図 ポリエチレン-スチレン-ジビニルベンゼングラフトポリ マーのゲル量とグラフト量の関 係に及ぼす DVB の効果(ポリ エチレンは厚の 0.085 mm の Alathon 10)



#### 8.5 ジビニルベンゼンの効果

ポリエチレンにスチレンをグラフト重 合した場合は熱キシレンに完全に溶解 し, まったく不溶解物を残さなかったこ とを前に述べたが,古くからポリスチレ ンの架橋剤として知られているジビニル ベンゼン (DVB) を1~15% の範囲でス チレンと共存させて、その架橋効果を検 討した。 DVB は市販品をそのまま用い た。これは DVB とエチルビニルベンゼ ンの55:45の混合物である。スチレンに DVBを一定量混ぜて、これにポリエチレ ンを浸し、いくぶん膨潤した状態で γ線 を照射した。 DVB の増加とともにかな りグラフト重合速度が低下したが、これ は主として DVB 中に含まれていると推 定される重合防止剤のためと思われる。 生じたグラフトポリマーの熱キシレンに 溶解しないで残ったゲル量とグラフト量 の関係をDVBをパラメータとして第30 図に示した。 DVBの1%添加でも架橋 効果の著しいことがわかる。第31図は これらゲルの80°Cにおける熱キシレン 中の重量膨潤比を示した。次に第32図 に引張強さおよび伸びに及ぼす DVBの 添加量の影響を示し,第33図は同じく グラフト量の影響を示している。DVBの 添加とともに引張強さは増大するが,伸 びは著しく減少する。 なお横河製 Q メータを用いて周波数 105~107 c/s にわたって常温の誘電正接 および誘電率を測定した。測定値はかな りばらついたが、いずれも誘電正接は 4×10<sup>-4</sup> 以下であり, 誘電率は 2.2~2.45 程度で,この点からはすぐれた絶縁材料 と考えられる。

第32図 ポリエチレン-スチレン-ジビニルベンゼングラフトポリ マーの抗張力および伸びとDVB のスチレン中の濃度との関係 (DVB0%, 5%, 15%のものの グラフト量はそれぞれ 66.7, 69.6, 69.1%でほぼ近し, 0.085mm 厚の Alathon 10使用)

とグラフト量の関係を第29図に示す。伸びが等方的と 仮定すると,

 $(1+\alpha)^3 = 1 + x \cdot d_1/d_2$  .....(16) となる。ここで $\alpha$ は伸び率,  $d_1$ ,  $d_2$ はポリエチレンおよ びポリスチレンの比重, x はグラフト率である。この式 から曲線の傾斜はほぼ1/3になるが、Petrothene 210では かなりこれに近くなっている。 Marlex-50 ではそれよ りいくらか伸び率が小さい。伸びにはモノマーの膨潤度 がおもに関係しているように思われるが、詳細は明らか でない。以上の事実からこの場合は表面グラフトよりむ しろかなり均一なグラフトであることがうかがわれる。

#### 8.6 赤外線分析

ポリエチレンおよびこれにアクリロニトリルならびに スチレンをグラフト重合したもの, さらにポリアクリロ ニトリル,ポリスチレンの赤外線吸収スペクトルを第 34~38図に示す。アクリロニトリルグラフトポリマー では 4.4 µ, 8.0 µ 付近にポリアクリロニトリルに属する 吸収が現われ、スチレングラフトポリマーでは 6.24µ, 9.3µ, 9.7µ, 11.0µ付近にポリスチレンに属する吸収が現 われている。次にポリエチレン-スチレン-ジビニルベン ゼングラフトポリマーについて第39図に示す。12.6µの ところにスチレングラフトポリマーに存在しない新しい

---- 15 -----

# 昭和34年7月 絶縁材料特集号第2集 日立評論別冊第31号



第34図 低密度ポリエチレンの赤外吸収スペクトル (Polythene 511 D 厚さ 0.08 mm)



第35図 ポリエチレン-アクリロニトリルグラフトポリマーの赤外線吸収スペクトル (グラフト量17%, ポリエチレンは Petrothene 210の厚さ0.085 mm のもの使用)



第36図 ポリアクリロニトリルの赤外線吸収スペクトル (厚さ0.15~0.40mm)

吸収が出ている。これは, DVBの割合の多いものほど たとえば Marlex-50は1%程度の Dibenzyl Disulfide, 吸収が深くなっており,これがパラフェニレン基の吸収 と一致するので、 パラフェニレン基による架橋構造を示 すものと思われる。

# 9. ポリエチレンの紫外線による架橋

Oster 氏ら (48)は 200~300 mµ の紫外線によってもポ リエチレンの架橋を行うことができることを報告した。 外線が応用できる(50)。

Benzophenone, Diphenylamine 氏らの増感剤の存在で, 15ワットの水銀燈を1秒間照射すれば十分架橋が形成さ れ、150°Cの温度で cm<sup>2</sup> あたり 7.0 kg (100 psi) の荷重に 少なくも15分間耐えるようになる。しかも照射の効果は 12.7 mm (0.5")の深さに達するという。植松氏ら(49)も このことを確認している。またグラフト重合反応にも紫



第37図 ポリスチレンの赤外線吸収スペクトル (厚さ 0.13 mm)



第38図 ポリエチレン-スチレングラフトポリマーの吸収スペクトル (グラフト量 116%, 厚さ 0.16 mm, 用いたポリエチレンは 0.085 mm 厚の Alathon 10)



第 39 図 ポリエチレン-スチレン-ジビニルベンゼングラフトポリマーの赤外線吸収スペクトル (グラフト量 65.1%, DVB 15%, 厚さ 0.11 mm, 用いたポリエチレンは 0.085mm厚の Alathon 10)

## 10. ポリエチレンの塩素化

最近,林氏ら<sup>(51)</sup>はポリエチレンの放射線による塩素 化の実験を行ったことを報告したが,詳細は発表されず, ポリスチレンについてかなり詳しい報告がされた。すな わち,ポリスチレンでは 0.49~2.59×10<sup>5</sup>rep のγ線照射 で塩素化の見かけのG値は 10×10<sup>5</sup> くらいで非常に大き い。このようにG値の高い点からも将来この方面の研究 も盛んになるものと期待される。

# 11. 結 言

ポリエチレンの放射線加工について,主としてポリエ チレンの架橋,ポリエチレンのグラフト重合について, われわれの研究室における実験を中心として紹介した が,現在のところまだ加工に要する費用はかなり高くつ いており,将来性は主として照射に要する費用で決まる と考えられる。これらの分野はまだいとぐちについたば かりといってよい状態であり,今後の発展が期待される

---- 17 -----

絶縁材料特集号 第2集

が、これらの研究に刺激されて、化学的な方法などによる ポリエチレンの加工もしだいに関心を高めつつある。た とえば、ジクミルパーオキサイドそのほかによるポリエ チレンのキュアリングにより放射線加工と同様に十分架 橋させることもできるし、また上に述べた紫外線利用も その一例と考えられる。さらにグラフト反応においても ポリエチレンにオゾンを作用させてオゾン酸化してグラ フト重合させることや、また熱酸化してグラフト重合さ せることもできるので、これら化学的方法は放射線加工 の実験結果に基いて類推され生れてきたものが多く、こ の意味でも放射線利用の研究はますます発展するものと 考えられる。

上に述べた研究は日立製作所中央研究所河合鱗次郎博 士の御指導のもとに始めたものであるが,さらに研究を 行うにあたり所内外の多数のかたがたの御指導御援助を いただいた。関係者各位に厚く御礼申しあげる。

#### 参考文献

- (1) A. Charlesby: Proc. Roy. Soc., A 215, 187 (1952)
- (2) Chem. Eng. News: **32**, 1392 (1954); **31**, 1948 (1953)
- (3) 深田: 日立中研における講演(昭和33-6)

- (19) P. J. Flory: J. Phys. Chem., 46, 132 (1942)
- (20) A. Charlesby: J. Polymer Sci., 11, 513 (1953)
- (21) P. Alexander & D. Toms: J. Polymer Sci., 22, 343 (1956)
- (22) R. W. Pearson: J. Polymer Sci., 25, 189 (1957)
- (23) L. H. Tung: J. Polymer Sci., 24, 333 (1957)
- (24) W. F. Busse & G. H. Bowers: J. Polymer Sci., 31, 252 (1958)
- (25) P. J. Flory: J. Chem. Phys., 18, 108 (1950)
- (26) P. J. Flory: Chem. Rev., 35, 51 (1944)
- (27) E. J. Lawton, J. S. Balwit & A. M. Bueche: Ind.Eng. Chem., 46, 1703 (1954)
- (28) H. Luy & K. Schumacher: Z. Angew. Phys.,
  8, 222 (1956); D. S. Ballentine, etc.: J. Polymer Sci., 13, 410 (1954)
- (29) Chem. Eng. News: 32, 1342 (1954); Chem,
   Eng. News: 1958, May 5 p. 42
- (30) A. Charlesby: Radiation Research, 2, 96(1955)
- (31) 前田,中田: 応用物理 27, 304 (1958)
- (32) 川松,新井: 高分子化学投稿中
- (33) L. E. St. Pierre & H. A. Dewhurst: J. Chem. Phys., 29, 241 (1958)
- (34) N. Bach: Peaceful Uses of Atomic Energy (United Nation), 7, 538 (1956)
- (35) A. Chapiro: J. Chim. Phys., 52, 255 (1955)
- (36) M. Magat: 東京大学における講演要旨 昭和 33
   年9月(日本放射線高分子研究協会)
- (37) D. T. Turner: J. Polymer Sci., 27, 503 (1958);
   Rubber Chem. & Techn., 31, 737 (1958)
- (4) E. E. McSweeney & E. L. Kropa: Ind. Eng. Chem., 50, 30 A (1958 Jan.)
- (5) Chem. Eng. News: 34, 5099 (1956 Oct. 22)
- (6) Rubber J.: 1957 Sept. p. 304
- (7) P. A. Goodwin: Mod. Plast., 32, [7] 102(1955);
  F. J. Bockhoff & J. A. Neumann: Mod. Plast.,
  32 [7] 103 (1955); P. A. Goodwin & J. W.
  Wetzel: G. E. Review, 58, 48 (1955); J. B.
  Meikle & B. Graham: Electronics, 29, 146 (1956); K. I. Mackenzie & R. A. Ward: Elec.
  Manuf., 61, 56 (1958)
- (8) 篠原健一: 高分子 6, 166 (1957), 化学と工業11, 684 (1958)
- (9) 篠原,雨宮,団野,ほか: 日本物理学会31年7月年 会ほか
- (10) いけだ: 高分子 7,74 (1958); C. H. Stockman & G. R. Bauman: Chem. Eng. News, 35, 16 (1957 August 5)
- (11) 河合,そのほか:工化誌 60,844 (1957); 高分子化学 15,523 (1958)
- (12) M. Dole, C. D. Keeling & D. G. Rose: J. Am. Chem. Soc., 76, 4304 (1954)
- (13) A. A. Miller, E. J. Lawton & J. S. Balwit: J. Phys. Chem., 60, 599 (1956)
- (14) A. Charlesby & W. H. T. Davison: Chem. & Ind., 1957, 232
- (15) M. Dole, D. C. Milner & T. F. Williams: J. Am. Chem. Soc., 80, 1580 (1958)
- (16) H. A. Dewhurst: J. Phys. Chem., 62, 15 (1958)
- (17) 日本特許公報: 昭 33-6783, 公報 昭和33年8月 19日
- (18) A. Chapiro : J. Chim. Phys., 52, 246 (1955)

- (38) L. W. Epstein: J. Polymer Sci., 26, 399 (1957)
- (39) E. J. Lawton, J.S. Balwit & R. S. Powell: J. Polymer Sci., 32, 257 (1958)
- (40) F. B. Waddington: J. Polymer Sci, 31, 221 (1958)
- (41) C. W. Miller: Brit. Inst. Radio Engrs., J 14, No. 12 (1954)
- (42) 川和田: 原研1万キュリーコバルト試用者中間 報告 昭和34年1月
- (43) 日本特許公告 昭 33-8543 昭和 33年9月24日, 仏 特許 1,125,537 (1955, 4月29日出願), 1,130,100 (1955, 5月31日出願), なお 1,130,099(1955年5 月31日出願) は普通のグラフト重合の特許である
- (44) A. Chapiro: J. Polymer Sci., 23, 337(1957); J. Polymer Sci., 26, 321 (1958)
   M. Magat: 大阪における講演要旨 昭33年10月 (日本放射線高分子研究協会)
- (45) J. J. Harwood, H. H. Hausner, J. G. Morse & W.
  G. Rauch: The Effect of Radiation on Materials 1958 p. 300 BNL 414 (T-81) October 1956
- (46) 篠原,柏木: 高分子学会第7回年次大会講演要旨
   集 p. 34 (昭和33年6月)
- (47) A. E. Woodward, C. W. Deeley, D. E. Kline & J. A. Sauer: J. Polymer Sci., 26, 383 (1957)
- (48) G. Oster: J. Polymer Sci., 22, 185 (1956)
   桜田一郎: 高分子 6, 107 (1957)
- (49) 植松,高橋,金丸: 高分子学会第7回年次大会講 演要旨集 p. 40 (1958)
- (50) G. Oster & G. K. Oster: Chem. Eng. News, 1957 Sept. 30, p. 101
- (51) 林,岡村: 放射線討論会(東工大,昭和33年11月)

